第一章 PN结



PN 结是其他微电子器件的基础。

PN 结的常见应用有:太阳能电池, GaAs / GaN 激光器,有机发光二极管,雪崩光电二极管, CMOS 图像传感器。OLED 是有机半导体的显示材料,怕水,寿命有限。

1.1 PN 结的形成

PN 结最早是通过热扩散,目前有沉积、扩散、激光掺杂等工艺。

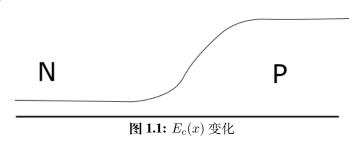
一般掺杂得到的是二维的器件,电流方向不是直线,难以求解。若是得到的是一个 很窄的器件,可以简化为一个一维问题,对第二个维度的依赖性会变低,只需考虑第一 维度的运动情况。

两种半导体直接相连是不能得到 PN 结的,因为断面上的原子不能形成化学键。对 N 型半导体,费米能级靠近导带,对于 P 型半导体,靠近价带。在两个体区中,N 型中 很多的施主杂质电离的正离子(无法移动),但是有等量的电子(可以移动, $n=N_D$);类似的 P 型存在可以移动的空穴($p=N_A$)。浓度差造成了扩散,那么 N 型靠近结区的 部分电子被中和,整体带正电,P 型对应部分带负电,这就是耗尽区。由于扩散的存在,出现 $n\cdot p>n_i^2$ 的瞬态。

电流分为两部分,漂移电流以及扩散电流。之前考虑的是扩散电流,因为此时还没有出现两部分的电势差。由于扩散后出现了静电荷,形成了电场,开始考虑漂移电流。电场逐渐增大,受到的阻力也越来越大,直到扩散电流与漂移电流相互抵消,进入稳态,即完成形成过程。

可以分为两个体区以及耗尽区(空间电荷区),耗尽区中没有自由移动的电荷,N型一侧有 $n \ll n_0$,另一侧有 $p \ll p_0$ 。

 $E_c(x)$ 如图 1.1



n(x) 满足

$$n(x) = N_c \exp(-\frac{E_c(x) - E_F}{kT})$$

其中, $E_c - E_F \approx 0.06 eV$, $kT \approx 26 meV$.

依靠本式,得到,空间电荷区几乎没有自由电荷。最后的分布如图??

